PAT-NO:

JP02000056399A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2000056399 A

TITLE:

PHOTOGRAPHIC PRINTER

PUBN-DATE:

February 25, 2000

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NISHIKAWA, HIDETOSHI

N/A

TSUKAMOTO, KAZUYA

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NORITSU KOKI CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP10220549

APPL-DATE: August 4, 1998

INT-CL (IPC): G03B027/32, G02B026/08

### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To miniaturize a device and to reduce exposure nonuniformity.

SOLUTION: A PBS(polarizing beam splitter) 3 guiding light from a light source I to a DMD(digital micro-mirror device) 5, and guiding the light deflected by the DMD 5 and reaching the DMD 5 to a photographic paper 6 is arranged in an optical path between the light source I and the DMD 5 as a deflection means. The DMD 5 is arranged so that the light from the PBS 3 is made perpendicularly incident, and is provided with plural micro-mirrors rocking in accordance with image data. In this constitution, since the respective optical parts are arranged so that the incident angle of light to

04/05/2004, EAST Version: 1.4.1

the DMD 5 becomes zero, the layout of a light source part can be made small. Thus, the optical parts are prevented from being extended and arranged while centering the deflecting means to an extent that an incident angle is conventionally formed to a certain extent with respect to the deflecting means. Since the respective micro-mirrors are arranged to be nearly symmetry each other with respect to an optical axis connecting the PBS 3 and the DMD 5, the difference of distances between the light source 1 and each micro-mirrors is little.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-56399

(P2000 - 56399A)

(43)公開日 平成12年2月25日(2000.2.25)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G 0 3 B	27/32	G 0 3 B	27/32 Z	2H041
G 0 2 B	26/08	G 0 2 B	26/08 E	2H106

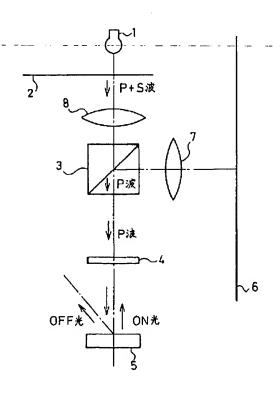
#### 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)

		<b>普 質明 水</b>	木間水 明水坝の数 / OL (宝 9 貝)
(21)出願番号	特顧平10-220549	(71)出願人	000135313 ノーリツ鋼機株式会社
(22)出顧日	平成10年8月4日(1998.8.4)	(72)発明者	和歌山県和歌山市梅原579番地の 1 西川 英利 和歌山県和歌山市梅原579- 1 ノーリツ
		(72)発明者	鋼機株式会社内 塚本 和也 和歌山県和歌山市梅原579-1 ノーリツ
		(74)代理人	鋼機株式会社内 100080034 弁理士 原 謙三
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 写真焼付装置

### (57)【要約】

【課題】 装置を小型化する。露光ムラを低減する。 【解決手段】 光源1と偏向手段としてのDMD5との 間の光路中に、光源1からの光をDMD5に導く一方、 DMD 5にて偏向されて届いた光を印画紙6に導くPB S3を配置する。DMD5は、PBS3からの光が垂直 に入射するように配置されており、画像データに応じて 揺動する複数のマイクロミラーを備えている。この構成 では、DMD5に対する光の入射角がゼロとなるように 各光学部品を配置すればよいので、光源部のレイアウト が小さくまとまる。つまり、偏向手段に対してある程度 入射角を付ける従来ほどまで、偏向手段を中心として各 光学部品を広げて配置しなくても済む。また、各マイク ロミラーは、PBS3とDMD5とを結ぶ光軸に対して 互いにほぼ対称となるように配置されているので、光源 1と個々のマイクロミラーとの距離にほとんど差がなく なる。



04/05/2004, EAST Version: 1.4.1

1

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】光源からの光を画像データに応じて画素ご とに偏向させる偏向手段を備え、偏向手段を介して得ら れる光で感光材料を露光することにより、感光材料に画 像を焼き付ける写真焼付装置において、

上記光源と上記偏向手段との間の光路中に、上記光源か らの光を上記偏向手段に導く一方、上記偏向手段によっ て偏向されて届いた光を感光材料に導く光学素子をさら に備え、

上記偏向手段は、上記光学素子からの光が垂直に入射す るように配置されていることを特徴とする写真焼付装 置。

【請求項2】上記光学素子と上記偏向手段との間の光路 中に、入射光の水平成分、垂直成分間で位相差を発生さ せる位相差発生手段をさらに備えていることを特徴とす る請求項1に記載の写真焼付装置。

【請求項3】上記位相差発生手段を往復透過した光は、 上記位相差発生手段を往復透過する前の光の水平成分、 垂直成分間で半波長の奇数倍の位相差が付与されてなる 装置。

【請求項4】上記位相差発生手段は、1/4波長板であ ることを特徴とする請求項3に記載の写真焼付装置。

【請求項5】上記偏向手段は、上記画素に対応してマト リクス状に配置され、画像データに応じて揺動される複 数のマイクロミラーを有するデジタル・マイクロミラー ・デバイスであることを特徴とする請求項1ないし4の いずれかに記載の写真焼付装置。

【請求項6】各マイクロミラーは、感光材料の露光時 光反射面が垂直になるように位置する一方、感光材料の 非露光時に、上記光軸に対して光反射面が傾斜するよう に位置することを特徴とする請求項5に記載の写真焼付 装置。

【請求項7】上記偏向手段は、各画素における光の出射 を画像データに応じて制御する反射型液晶表示装置であ ることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載 の写真焼付装置。

### 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばデジタル・ マイクロミラー・デバイス(以下、DMDと略称する) や反射型液晶表示装置等の画像表示装置を介して、感光 材料としての印画紙を露光することにより、印画紙に画 像を焼き付ける写真焼付装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】従来から、例えばDMDを備えた写真焼 付装置が種々提案されている。DMDは、図6(a) (b) に示すように、微小サイズの揺動自在なマイクロ られてなるデバイスである。画像データに応じて個々の マイクロミラー51の傾きを調節し、光の反射方向を変 えることで、印画紙の露光が制御される。

【0003】つまり、印画紙の露光時には、マイクロミ ラー51は、同図(a)に示すように、基板53表面に 対して時計回りに $\theta$ だけ傾き( $-\theta$ だけ傾き)、光源か らの光がマイクロミラー51によって印画紙方向に反射 される。一方、印画紙の非露光時には、マイクロミラー 51は、同図(b)に示すように、基板53表面に対し 10 て反時計回りに $\theta$ だけ傾き( $+\theta$ だけ傾き)、光源から の光がマイクロミラー51によって印画紙方向とは異な る方向に反射される。なお、マイクロミラー51は、装 置の電源ON時またはOFF時に、同図(a)(b)の いずれか一方の状態を呈している。

【0004】このようなDMDを用いた写真焼付装置 は、例えば、特開平8-262582号公報、特開平9 -160140号公報、特開平9-160141号公 報、特開平9-164723号公報、特開平9-164 727号公報に開示されている。これらの従来技術は、 ものであることを特徴とする請求項2に記載の写真焼付 20 いずれも、図7に示すように、印画紙61の露光時に は、光源62からの光がDMD63にて印画紙61方向 に反射されるように、DMD63のマイクロミラー(図 示せず)を基板表面に対して所定角度傾ける一方、印画 紙61の非露光時には、光源62からの光がマイクロミ ラーにて光吸収板64方向に反射されるように(光路が off側へ向くように)、マイクロミラーを基板表面に 対して傾斜させる構成となっている。

【0005】また、光源62とDMD63との間には、 入射光を集光させてDMD63に照射するコンデンサレ に、上記光学素子と上記偏向手段とを結ぶ光軸に対して 30 ンズ65が設けられている。このコンデンサレンズ65 は、DMD63にて反射されて印画紙61に向かう光と 当該コンデンサレンズ 65とが部分的に干渉するのを回 避するため、干渉するおそれのある部分がカットされて 配置されている。同図中の仮想線は、干渉するおそれの ある部分(カットされている部分)を示している。

> MD63との間には、必要に応じて、調光フィルタ、防 熱フィルタ、バランスフィルタなどの光学部品が配置さ れる。調光フィルタは、光源62から出射される白色光 40 からR(赤)、G(緑)、B(青)の各色の光を取り出 すものである。防熱フィルタは赤外線をカットし、バラ ンスフィルタは、DMD63の表面に均一な照度で光が 照射されるようにシェーディング補正をする。一方、D MD63と印画紙61との間には、必要に応じて、投影 レンズ、ネガフィルムなどが配置される。

【0006】なお、図示はしていないが、光源62とD

### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、光源6 2からの光をDMD63に対して斜めから入射させる上 記従来の構成では、DMD63に対して光の入射角があ ミラー51がポスト52を介して基板53上に複数設け 50 る程度付くように各光学部品を配置する必要がある。そ

のため、各光学部品の配置に広いスペースを要し、装置 が大型化するという問題が生ずる。

【0008】なお、例えば、光源62とDMD63との 距離を狭めることによって上記の問題を回避する方法も 考えられる。しかし、光源62とDMD63との間に は、必要に応じて、上述した光学部品が配置されるた め、光源62とDMD63との距離の短縮には限界があ る。また、DMD63と印画紙61との距離の短縮につ いても同様である。したがって、この方法では、装置を 大幅に小型化することはできない。

【0009】本発明は、上記の問題点を解決するために なされたもので、その目的は、DMD等の画像表示装置 を備えた写真焼付装置において、装置を大幅に小型化す ることができる写真焼付装置を提供することにある。 [0010]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明に係る写 真焼付装置は、上記の課題を解決するために、光源から の光を画像データに応じて画素ごとに偏向させる偏向手 段を備え、偏向手段を介して得られる光で感光材料を露 光することにより、感光材料に画像を焼き付ける写真焼 20 付装置において、上記光源と上記偏向手段との間の光路 中に、上記光源からの光を上記偏向手段に導く一方、上 記偏向手段によって偏向されて届いた光を感光材料に導 く光学素子をさらに備え、上記偏向手段は、上記光学素 子からの光が垂直に入射するように配置されていること を特徴としている。

【0011】上記の構成によれば、光源からの光は、光 学素子を介して偏向手段に入射し、偏向手段にて画像デ ータに応じて偏向される。そして、偏向された光のう 材料に導かれる。これにより、画像データに応じた画像 が感光材料に焼き付けられる。

【0012】ここで、偏向手段は、光学素子からの光が 垂直に入射するように配置されているので、偏向手段に 対してある程度入射角を付ける従来のように、各構成部 材の配置に広スペースを要しない。つまり、上記構成で は、偏向手段に対して光の入射角がほぼゼロとなるよう に各構成部材を配置するので、従来よりも各構成部材の 配置スペースを狭めることができる。これにより、従来 に比べて装置を大幅に小型化することができる。

【0013】請求項2の発明に係る写真焼付装置は、上 記の課題を解決するために、請求項1の構成に加えて、 上記光学素子と上記偏向手段との間の光路中に、入射光 の水平成分、垂直成分間で位相差を発生させる位相差発 生手段をさらに備えていることを特徴としている。

【0014】上記の構成によれば、位相差発生手段に入 射する光学素子からの光を第1の光とすると、この第1 の光は、位相差発生手段を透過し、偏向手段にて偏向さ れて再び位相差発生手段を透過することで、第1の光と は振動方向の異なる第2の光に変換される。これによ

り、上記の光学素子を、例えば第1の光を偏向手段の方 向に透過(反射)させる一方、第2の光を感光材料の方 向に反射(透過)させる偏光ビームスプリッタで構成す ることが可能となる。つまり、光学素子として既存の光 学部品を適用することができる。

【0015】請求項3の発明に係る写真焼付装置は、上 記の課題を解決するために、請求項2の構成において、 上記位相差発生手段を往復透過した光は、上記位相差発 生手段を往復透過する前の光の水平成分、垂直成分間で 10 半波長の奇数倍の位相差が付与されてなるものであるこ とを特徴としている。

【0016】上記の構成によれば、位相差発生手段を往 復透過する前の光が例えばP偏光であれば、位相差発生 手段を往復透過した光はS偏光となり、逆に、位相差発 生手段を往復透過する前の光がS偏光であれば、位相差 発生手段を往復透過した光はP偏光となる。

【0017】したがって、偏波面の異なる2つの直線偏 光を利用して感光材料への画像の焼き付けを行うことが 可能となる。

【0018】請求項4の発明に係る写真焼付装置は、上 記の課題を解決するために、請求項3の構成において、 上記位相差発生手段は、1/4波長板であることを特徴 としている。

【0019】上記の構成によれば、位相差発生手段を1 /4波長板で構成することにより、1/4波長板の往復 透過によって、P偏光はS偏光に、S偏光はP偏光にそ れぞれ確実に変換される。したがって、請求項3の構成 による効果を確実に得ることができる。

【0020】請求項5の発明に係る写真焼付装置は、上 ち、光学素子に届いた光は、この光学素子によって感光 30 記の課題を解決するために、請求項1ないし4のいずれ かの構成において、上記偏向手段は、上記画素に対応し てマトリクス状に配置され、画像データに応じて揺動さ れる複数のマイクロミラーを有するデジタル・マイクロ ミラー・デバイスであることを特徴としている。

> 【0021】上記の構成によれば、光源からの入射光を 反射させる各マイクロミラーを画像データに応じて揺動 させることにより、画像データに基づいた画像を感光材 料に確実に焼き付けることができる。

【0022】請求項6の発明に係る写真焼付装置は、上 40 記の課題を解決するために、請求項5の構成において、 各マイクロミラーは、感光材料の露光時に、上記光学素 子と上記偏向手段とを結ぶ光軸に対して光反射面が垂直 になるように位置する一方、感光材料の非露光時に、上 記光軸に対して光反射面が傾斜するように位置すること を特徴としている。

【0023】上記の構成によれば、光学素子からマイク ロミラーに入射する光は、感光材料の露光時には再び光 学素子方向に反射され、光学素子の作用により感光材料 に導かれる一方、感光材料の非露光時にはマイクロミラ 50 一にて光学素子とは異なる方向に反射される。このよう

に、感光材料の露光時と非露光時とでマイクロミラーの 傾斜が変わるので、感光材料の露光/非露光の切り換え を確実に行うことができる。

【0024】請求項7の発明に係る写真焼付装置は、上 記の課題を解決するために、請求項1ないし4のいずれ かの構成において、上記偏向手段は、各画素における光 の出射を画像データに応じて制御する反射型液晶表示装 置であることを特徴としている。

【〇〇25】上記の構成によれば、反射型液晶表示装置 では、この反射型液晶表示装置に供給される光の光学素 子方向への反射が、画像データに応じて画素ごとに制御 されるので、偏向手段をデジタル・マイクロミラー・デ バイスで構成したときと同様、画像データに基づいた画 像を感光材料に確実に焼き付けることができる。

[0026]

【発明の実施の形態】本発明の実施の一形態について、 図1ないし図5に基づいて説明すれば、以下の通りであ る。

【0027】本実施形態に係る写真処理装置は、図3に 示すように、光源1とDMD5(偏向手段)とを結ぶ光 20 リセル(図示せず)と、各メモリセルに対応した複数の 路上に、BGRホイール2、偏光ビームスプリッタ(以 下、PBSと略称する)3、1/4波長板4(位相差発 生手段)がこの順で直線状に配置されて構成されてい

【0028】光源1は、白色光を出射する例えばハロゲ ンランプで構成される。BGRホイール2は、青

(B)、緑(G)、赤(R)の各色フィルタ2a・2b ·2cを有する回転板であり、回転時には、光源1とP BS3とを結ぶ光路上にいずれか一つの色フィルタが位 置するようになっている。これにより、青色光、緑色 光、赤色光を順に印画紙6に供給してカラーの画像1コ 「マを焼き付けることが可能となる。

【0029】PBS3は、BGRホイール2を透過した 光源1からの光をDMD5に導く一方、DMD5にて偏 向されて届いた光を印画紙6に導く光学素子である。具 体的には、PBS3は、BGRホイール2を透過した光 源1からの光のうち、P偏光のみDMD5方向に透過さ せる一方、DMD5から1/4波長板4を介して得られ るS偏光を印画紙6方向に反射させる。なお、上記のP 偏光は、光の電気ベクトルの振動方向がPBS3の光入 40 射面に平行な直線偏光であり、上記のS偏光は、上記P 偏光に対して偏波面 (振動面)が垂直な直線偏光であ る。

【0030】このように、光源1とDMD5との間の光 路中に、既存の光学部品であるPBS3を光学素子とし て配置できるのは、PBS3とDMD5との間の光路中 に次に説明する1/4波長板4を配置しているためであ

【0031】1/4波長板4は、入射した直線偏光の垂 直成分および水平成分の波長にπ/2(1/4波長)の 50 イクロミラー5 bを揺動させるコントローラ(図示せ

位相差を生じさせる。本実施形態では、後述するよう に、1/4波長板4を往復透過させてから印画紙6に光 を照射するので、結局、上記二成分間で半波長分の位相 差が生じる。これにより、1/4波長板4に入射する光 がP偏光であれば往復透過によりS偏光に、入射光がS

偏光であればP偏光に変換されることになる。

【0032】したがって、1/4波長板4を配置するこ とにより、互いに偏波面の異なる直線偏光を利用するこ とができるので、上記光学素子として、一方の直線偏光 を透過させ、他方の直線偏光を反射させる既存のPBS 3を用いることができる。位相差発生手段としては、上 記の1/4波長板4以外に、位相差発生手段を往復透過 する前の光において、水平成分、垂直成分間で半波長の 奇数倍の位相差を生じさせるものであればよい。

【0033】DMD5は、光源1からの光を画像データ に応じて画素ごとに偏向させるものであり、PBS3か らの光が垂直に入射するように配置されている。このD MD5は、図4(a)(b)に示すように、基板5a と、基板5a上にマトリクス状に設けられる複数のメモ マイクロミラー5bとを備えている。

【0034】基板5aは、その表面がPBS3とDMD 5とを結ぶ光軸に対して垂直となるように設けられてい る。各マイクロミラー5bは、揺動可能なようにポスト 5cを介して基板5a上に設けられている。1個のマイ クロミラー5 bは、1 画素に対応している。

【0035】各マイクロミラー5bは、PBS3とDM D5とを結ぶ光軸に対して互いにほぼ対称となるように 配置されている。従来では、入射光がDMDに対して斜 30 めから入射する構成のため、光源とDMDの個々のマイ クロミラーとの距離(光路長)に様々な差が生じ、その 結果、焼き付け画像に露光ムラが生じていたが、本実施 形態のようなマイクロミラー56の配置では、光源1と 個々のマイクロミラー5bとの距離にほぼ差がなくなる と考えて差し支えない。したがって、光路長の差に起因 して露光ムラが発生するのを低減することができる。

【0036】なお、光源1と個々のマイクロミラー56 との距離がほぼ均等になるのであれば、各マイクロミラ ー5bはPBS3とDMD5とを結ぶ光軸に対して多少 非対称で配置されていても構わない。

【0037】なお、上記の露光ムラの低減は、光路中に バランスフィルタを配置することによって幾分改善する ことが可能であるが、この場合、部品点数の増加によっ て装置が大型化するのであまり好ましくはない。つま り、本実施形態の構成では、バランスフィルタを設ける ことなく(装置が大型化することなく)、露光ムラを低 減できるのである。

【0038】DMD5は、画像データに応じて2値の信 号をメモリセルに供給し、上記メモリセルに対応するマ

04/05/2004, EAST Version: 1.4.1

ず)を備えている。上記コントローラから各メモリセル に画像データに応じて『1』または『0』の信号が付与 されることにより、メモリセルとマイクロミラー5bと の間で静電気的な吸引と反発とが生じ、これによって、 各マイクロミラー5bが揺動するようになっている。

【0039】具体的には、印画紙6の露光時には、印画 紙6の露光部分に対応するDMD5のメモリセルに、コ ントローラから例えば『1』の信号が供給される。する と、上記メモリセルに対応するマイクロミラー5 bが、 基板5aに対して平行(PBS3と基板5aとを結ぶ光 10 る)があるが、PBS3の作用により、P偏光のみPB 軸に対して垂直)になるように駆動される(図4(a) 参照)。これにより、マイクロミラー5 bへの入射光 は、入射方向と逆方向に反射されるようになる。

【0040】一方、印画紙6の非露光時には、印画紙6 の非露光部分に対応するDMD5のメモリセルに、コン トローラから例えば『〇』の信号が供給される。する と、上記メモリセルに対応するマイクロミラー5bが、 基板5aに対して所定角度傾くように駆動される(図4 (b) 参照)。これにより、マイクロミラー5bにて反 光路から外れ、印画紙6に到達しない。

【0041】このように、本写真焼付装置では、印画紙 6の露光時のみ、光源1からの光をPBS3方向に偏向 させるようになっており、光源1からの光がDMD5に 対して垂直に入射し、かつ、露光に供される光がDMD 5から垂直に出射される点(DMD5への入射直前の光 の光路と、露光に供されるDMD5からの反射直後の光 の光路とが同一となる点)で従来と異なっている。

【0042】なお、マイクロミラー5bは、装置の電源 ON時またはOFF時に、図4(a)(b)のいずれか 30 一方の状態となるようにコントローラによって駆動され るようになっている。

【0043】また、図3に示すように、PBS3と印画 紙6との間の光路中には、焼付レンズ(引き伸ばしレン ズとも言う) 7が設けられており、PBS3から印画紙 6に向かう光が、焼付レンズ6にて拡大されて印画紙6 に照射されるようになっている。なお、印画紙6は、勿 論、光源1とDMD5とを結ぶ光路上には位置していな 11

【0044】さらに、図1および図2に示すように、B 40 GRホイール2とPBS3との間の光路中にはコンデン サレンズ8が設けられており、光源1からの光がコンデ ンサレンズ8にて集光されてPBS3に供給されるよう になっている。本実施形態では、コンデンサレンズ8 は、DMD5、PBS3、印画紙6を結ぶ光路から外れ て位置しているため、DMD5にて反射された後の光 が、印画紙6に届く前にコンデンサレンズ8に入射する ことはない。なお、図3では、図面が複雑化するのを避 けるために、コンデンサレンズ8の図示を省略してい

【0045】次に、上記写真焼付装置の動作について、 図1および図2に基づいて以下に説明する。

【0046】光源1が点灯されると、光源1からの白色 光がBGRホイール2の例えば色フィルタ2a(図3参 照)を透過することにより、青色光がPBS3に入射す る。このとき、上記骨色光は、コンデンサレンズ8にて 集光され、ほぼ平行光となってPBS3に入射する。

【0047】ここで、PBS3への入射光としてはP偏 光およびS偏光(図面ではP波およびS波と記載してい S3を透過し、1/4波長板4に到達する。そして、上 記のP偏光は、1/4波長板4を透過することにより、 垂直成分および水平成分間で1/4波長の位相差が付け られた光となってDMD5に入射する。DMD5では、 画像データに応じた信号がコントローラからメモリセル に付与されることにより、上記メモリセルに対応したマ イクロミラー5 bが揺動する。

【0048】印画紙6の非露光時には、印画紙6の非露 光部分に対応するメモリセルにコントローラから『〇』 射される光は、マイクロミラー5bとPBS3とを結ぶ 20 の信号が供給されることにより、上記メモリセルに対応 するマイクロミラー5bが基板5aに対して所定角度傾 く。これにより、1/4波長板4を透過した光は、上記 のマイクロミラー5bで反射し、DMD5とPBS3と を結ぶ光路から外れる。したがって、上記の光はPBS 3を介して印画紙6には到達しない(同図中のOFF光 参照)。

> 【0049】一方、印画紙6の露光時には、印画紙6の 露光部分に対応するメモリセルにコントローラから

『1』の信号が供給されることにより、上記メモリセル に対応するマイクロミラー5bが基板5a表面に対して 平行となる。これにより、1/4波長板4を透過した光 は、上記のマイクロミラー5bによって入射方向と逆方 向(PBS3方向)に反射され、再び1/4波長板4に 入射する(同図中のON光参照)。1/4波長板4で は、入射光の垂直成分および水平成分の波長に再び1/ 4波長の位相差が付けられるので、1/4波長板4から PBS3方向に出射される光は、1/4波長板4を最初 に透過するP偏光の偏波面を90°回転させたS偏光と なる。つまり、P偏光は、1/4波長板4を往復透過す ることにより、偏波面が90°曲げられたS偏光とな

【0050】その後、1/4波長板4によって生成され たS偏光は、PBS3に入射し、PBS3の作用によ り、印画紙6方向に反射され、焼付レンズ7を介して印 画紙6に照射される。

【0051】このようにして青色光の露光が終了する と、次に、BGRホイール2を回転させ、光路上に色フ ィルタ2b・2c(図3参照)を順に位置させて、上記 と同様にして緑色光、赤色光の露光を同じ印画紙位置で 50 順に行う。このような3色の露光により、印画紙6に画 像1コマが焼き付けられる。その後は、印画紙6を搬送 し、上記と同様の動作を繰り返して次の画像1コマを焼 き付ける。

【0052】以上のように、本写真焼付装置は、DMD 5を一つの筐体と考えた場合に、光源1からの光がDM D5に対して垂直に入射し、露光に供される光がDMD 5から垂直に出射するように各光学部品を配置した構成 である。これにより、従来では、DMDに対して光の入 射角と反射角とをある程度付ける必要があったため、光 装置では、特に印画紙6の露光時にDMD5に対して光 の入射角と反射角とが両方ほぼゼロとなることからも分 かるように、入射角および反射角を小さくすることがで きるので、光学部品の配置に広スペースを要しない。し たがって、光源部のレイアウトを小さくまとめて、装置 を大幅にコンパクト化することができる。また、従来の ように、DMDに斜めから光を照射する構成よりも、装 置の設計が容易になるという利点もある。

【0053】さらに、従来では、先述したように、光源 の光をDMDに集光させるために設けられるコンデンサ 20 はS偏光)を反射させ、1/4波長板4からのS偏光 レンズが、DMDにて反射後の光と部分的に干渉するた め、レンズにおける干渉部分をカット(Dカット)する 必要があった (図7参照)。しかし、本写真焼付装置で は、DMD5と印画紙6との間の光路中にコンデンサレ ンズ8が位置していないため、コンデンサレンズ8とD MD5にて反射された後の光とが干渉することがない。 したがって、コンデンサレンズ8に対して、従来では必 要であったガラス製品の困難なDカット加工が必要では なく、その分、装置の価格低減を図ることも可能とな る。

【0054】ところで、本実施形態では、偏向手段をD MD5で構成した例について説明したが、例えば反射型 液晶表示装置で構成しても構わない。反射型液晶表示装 置は、例えばアクティブ素子であるTFT(Thin Film Transistor)を各画素ごとに有する透明基板(TFT基 板と称する)と、対向電極の形成された透明な対向基板 とで液晶層を挟持してなる液晶パネルの外側に、光源1 からの光を液晶層を介して反射する反射板を配置したも のである。この反射型液晶表示装置では、画像データに 応じて液晶層に印加する電圧を画素ごとに制御すること で、反射板にて反射され、液晶層を透過する光の透過率 が変化する。したがって、このような反射型液晶表示装 置も、光源1からの光を画像データに応じて画素ごとに 偏向させる偏向手段としての機能を有することになり、 DMD 5の代わりに反射型液晶表示装置を適用しても、 本実施形態と同様の効果を得ることができる。

【0055】特に、上記反射型液晶表示装置を、R、 G、Bのカラーフィルタを備えたもので構成した場合、 白色光を反射型液晶表示装置に供給するだけでR、G、 Bの各色の光を印画紙6に供給することができ、本実施 50 効果を奏する。 1.0

形態のようにBGRホイール2を配置して、画像1コマ に対して青色光、緑色光、赤色光を順に反射型液晶表示 装置に供給する必要がない。したがって、この場合、部 品点数を削減して装置の構成をさらに簡素化することが でき、これによって、装置の小型化をさらに図ることが できる。また、画像1コマに対して一度に骨色光、緑色 光、赤色光を印画紙6に照射することができるので、焼 き付け処理の速度も一段と向上する。

【0056】なお、本実施形態では、PBS3を、P偏 学部品の配置に広スペースを要していたが、本写真焼付 10 光を透過させる一方、S偏光を反射させる偏光ビームス プリッタで構成しているが、各光学部品の配置はそのま まとし、S偏光を透過させる一方、P偏光を反射させる **偏光ビームスプリッタで構成してもよい。この場合で** も、本実施形態と同様の効果が得られるのは勿論のこと である。

> 【0057】なお、本実施形態では、PBS3として、 光源1からのP偏光を透過させ、1/4波長板4からの S偏光を反射させる、透過→反射タイプの偏光ビームス プリッタで構成しているが、光源1からのP偏光(また (またはP偏光)を透過させる、反射→透過タイプの偏 光ビームスプリッタで構成しても勿論構わない。この場 合、各光学部品の配置は図5のようになる。すなわち、 DMD5、1/4波長板4、PBS3、焼付レンズ7、 印画紙6は、この順で直線状に配置される一方、光源1 からBGRホイール2およびコンデンサレンズ8を介し て入射する光が、PBS3にてDMD5方向に反射され るように、光源1、BGRホイール2、および、コンデ ンサレンズ8が配置される。この構成でも、本実施形態 30 と同様の効果が得られるのは言うまでもない。

【0058】なお、以上で説明した各構成部材の配置関 係はほんの一例に過ぎず、これに限定するわけではな W.

#### [0059]

【発明の効果】請求項1の発明に係る写真焼付装置は、 以上のように、上記光源と上記偏向手段との間の光路中 に、上記光源からの光を上記偏向手段に導く一方、上記 偏向手段によって偏向されて届いた光を感光材料に導く 光学素子をさらに備え、上記偏向手段は、上記光学素子 からの光が垂直に入射するように配置されている構成で ある。

【0060】それゆえ、偏向手段は、光学素子からの光 が垂直に入射するように配置されているので、偏向手段 に対してある程度入射角を付ける従来のように、各構成 部材の配置に広スペースを要しない。つまり、上記構成 では、偏向手段に対して光の入射角がほぼゼロとなるよ うに各構成部材を配置するので、従来よりも各構成部材 の配置スペースを狭めることができる。これにより、従 来に比べて装置を大幅に小型化することができるという

【 〇 〇 6 1 】請求項 2 の発明に係る写真焼付装置は、以上のように、請求項 1 の構成に加えて、上記光学素子と上記偏向手段との間の光路中に、入射光の水平成分、垂直成分間で位相差を発生させる位相差発生手段をさらに備えている構成である。

【〇〇62】それゆえ、上記の光学素子を、例えば第1の光を偏向手段の方向に透過(反射)させる一方、上記第1の光とは振動方向の異なる第2の光を感光材料の方向に反射(透過)させる偏光ビームスプリッタで構成することが可能となる。つまり、請求項1の構成による効 10果に加えて、光学素子として既存の光学部品を適用することができるという効果を奏する。

【 〇 〇 6 3 】請求項 3 の発明に係る写真焼付装置は、以上のように、請求項 2 の構成において、上記位相差発生手段を往復透過した光は、上記位相差発生手段を往復透過する前の光の水平成分、垂直成分間で半波長の奇数倍の位相差が付与されてなるものである構成である。

【0064】それゆえ、位相差発生手段の往復透過前後の光は、互いに偏波面の異なる直線偏光であるので、請求項2の構成による効果に加えて、これら2つの直線偏20 る。光を利用して感光材料への画像の焼き付けを行うことができるという効果を奏する。

【0065】請求項4の発明に係る写真焼付装置は、以上のように、請求項3の構成において、上記位相差発生手段は、1/4波長板である構成である。

【0066】それゆえ、1/4波長板の往復透過によって、P偏光はS偏光に、S偏光はP偏光にそれぞれ確実に変換されるので、請求項3の構成による効果を確実に得ることができるという効果を奏する。

【0067】請求項5の発明に係る写真焼付装置は、以 30 る。 上のように、請求項1ないし4のいずれかの構成におい 【覧 て、上記偏向手段は、上記画素に対応してマトリクス状 に配置され、画像データに応じて揺動される複数のマイ クロミラーを有するデジタル・マイクロミラー・デバイ 時に スである構成である。 る。

【0068】それゆえ、光源からの入射光を反射させる各マイクロミラーを画像データに応じて揺動させることにより、請求項1ないし4のいずれかの構成による効果に加えて、画像データに基づいた画像を感光材料に確実に焼き付けることができるという効果を奏する。

【0069】請求項6の発明に係る写真焼付装置は、以上のように、請求項5の構成において、各マイクロミラーは、感光材料の露光時に、上記光学素子と上記偏向手段とを結ぶ光軸に対して光反射面が垂直になるように位置する一方、感光材料の非露光時に、上記光軸に対して光反射面が傾斜するように位置する構成である。

12

【0070】それゆえ、感光材料の露光時と非露光時とでマイクロミラーの傾斜が変わるので、請求項5の構成による効果に加えて、感光材料の露光/非露光の切り換えを確実に行うことができるという効果を奏する。

【0071】請求項7の発明に係る写真焼付装置は、以上のように、請求項1ないし4のいずれかの構成において、上記偏向手段は、各画素における光の出射を画像データに応じて制御する反射型液晶表示装置である構成である。

【0072】それゆえ、反射型液晶表示装置に供給される光の光学素子方向への反射が、画像データに応じて画素ごとに制御されるので、請求項1ないし4のいずれかの構成による効果に加えて、偏向手段をデジタル・マイクロミラー・デバイスで構成したときと同様、画像データに基づいた画像を感光材料に確実に焼き付けることができるという効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る写真焼付装置の一構成例を示し、 光源からの光がDMDに導かれる過程を示す説明図である

【図2】上記写真焼付装置において、DMDにて反射された光が印画紙に導かれる過程を示す説明図である。

【図3】 上記写真焼付装置の概略の構成を示す斜視図で ある。

【図4】上記写真焼付装置において、(a)は、印画紙の露光時におけるマイクロミラーの配置位置を示す断面図であり、(b)は、印画紙の非露光時におけるマイクロミラーの配置位置を示す断面図である。

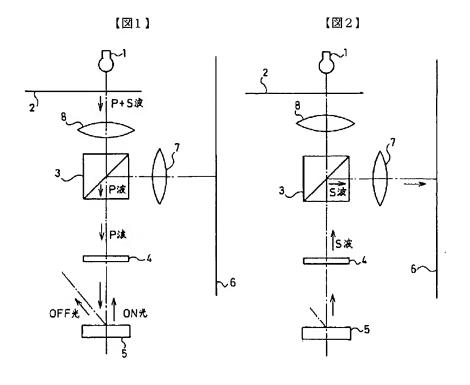
【図5】上記写真焼付装置の他の構成を示す説明図である。

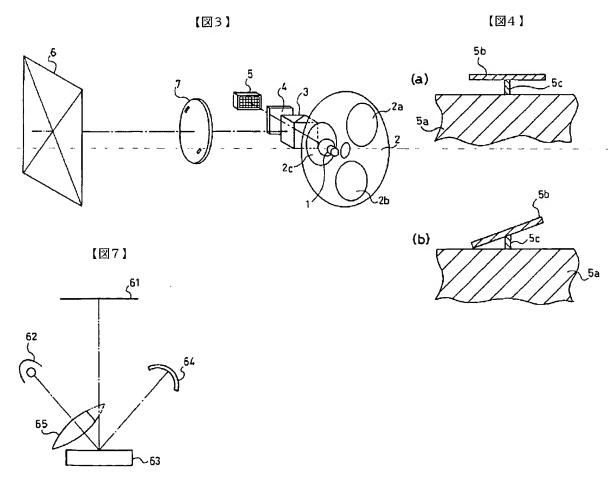
【図6】DMDを備えた従来の写真焼付装置において、(a)は、印画紙の露光時におけるマイクロミラーの配置位置を示す断面図であり、(b)は、印画紙の非露光時におけるマイクロミラーの配置位置を示す断面図である。

【図7】従来の写真焼付装置の概略の構成を簡単に示す 説明図である。

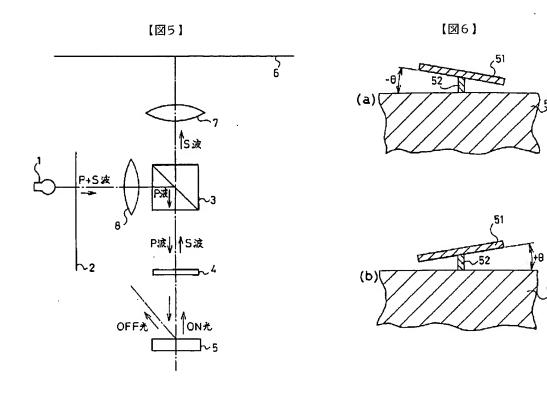
### 【符号の説明】

- 1 光源
- 40 3 PBS (光学素子、偏光ビームスプリッタ)
  - 4 1/4波長板(位相差発生手段)
  - 5 DMD (偏向手段、デジタル・マイクロミラー・ デバイス)
  - 5b マイクロミラー
  - 6 印画紙(感光材料)





04/05/2004, EAST Version: 1.4.1



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H041 AA04 AA30 AB12 AB30 AB36 AC06 2H106 AA02 AA44 AA71 AB04 AB71 BA01